

1. Спосіб формування нанокластерів у газовому потоці при іонному розпиленні в тліючому локальному розряді у з'єднаній з вакуумними насосами вакуумній камері, в якій закріплено мішень-катод і трубчастий анод, через який здійснюють подачу плазмоутворюючого газу, який **відрізняється** тим, що плазмоутворюючий газ подають в зону циліндричного електрода, який встановлюють на поверхні мішені-катода аксіально трубчастому аноду, а розмір нанокластерів та щільність їх потоку в утвореному в циліндричному електроді квазізамкненому об'ємі підвищеного тиску регулюють витратою плазмоутворюючого газу, висотою циліндричного електрода та величиною міжелектродної напруги.
2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що в квазізамкненому об'ємі створюють підвищений тиск в межах $1,33 \cdot 10^2$ - $1,33 \cdot 10^3$ Па.